## ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-300608

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)12月12日

G 01 B 11/24

21/20 1 0 1 Z

8304-2F 7907-2F

審査請求 有 請求項の数 2 (全8頁)

会発明の名称

3次元形状計測装置

②特 願 平1-122578

②出 願 平1(1989)5月16日

⑫発 明 者 河 野

明夫

大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号 オージー情報

システム株式会社内

⑩発明者 藤原

淳 一

大阪府大阪市住之江区南港東8丁目2番12号 株式会社オ

ージー情報システム総研南港研究所内

勿出 願 人 オージー情報システム

, Д

大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号

株式会社

株式会社オージー情報

システム総研

個代 理 人 弁理士 西教 圭一郎

大阪府豊中市新千里西町1丁目2番1号

最終頁に続く

願人

教 圭一郎 外1名

明 細 書

1、発明の名称

の出

3 次元形状計测装置

- 2、特許請求の範囲
- (1)複数の異なる位置にそれぞれ配置され、相互に異なる波長を有するパターン光またはスリット 光を被計測物体に同時に照射する複数の照射手段 と、

前記照射手段に個別的に対応してその対応する照射手段とは異なる位置にそれぞれ配置され、前記対応する照射手段からの前記波長を有する光が照射されている被計測物体を提像する複数の撮像手段と、

前記機像手段からの出力に応答して、撮像して得られる画面を多数の画素に分けて明暗の二値化を行い、その二値化信号をメモリにストアし、そのストア内容を読出して三角法に基づいて被計測物体の3次元の形状を演算して求める処理手段とを含むことを特徴とする3次元形状計測装置。

(2) 光照射手段と撮像手段とは、バンドパス色フ

イルタを備えることを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の3次元形状計測装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、たとえば産業用ロボツトの目などと して好適に実施することができる被計測物体の 3 次元形状を計測するための装置に関する。

従来の技術

典型的な先行技術では、被計測物体の形状を計測するために、たとえばプローブなどを被計測物体に当接しつつ移動を行い、アームの関節の角度などから被計測物体の形状を計測していた。

この先行技術では、プローブが被計測物体に接触する必要があり、したがつて被計測物体が柔らかいものや高温なものあるいは危険なものなどであるときには、計測を行うことができない。また被計測物体の表面を、少しずつずれて何回も走査しなければならず、計測に長時間要することになる。また構成

大がかりである。

、他の先行技術は、本件出願人による特願昭62 -211554に開示されている。この先行技術 では、被計測物体に光パターンを複数の各照射手 段によつて順次的に照射し、その照射手段に個別 的に対応してその対応する照射手段とは異なる位 置に設けられた擬像手段によつて、光パターン照 射期間中にその照射されている被計測物体を微像 し、この擬像手段の出力に悲づいて、三角法に従 い、被計測物体の形状を演算して求める。

発明が解決しようとする課題

このような先行技術では、複数の各照射手段を

頭次的に切換えて、被計測物体に光を照射しなければならず、そのため計測に長時間を必要とする。
したがつてたとえば被計測物体が人間などである
ときには、その被計測物体を長時間に亘つて静止
状態に保つことが困難であり、このような人間などのような被計測物体の形状計測は難しい。

本発明の目的は、被計測物体の3次元形状を、簡単な構成で高速に計測することができるように

-3-

次元形状計測装置である。

作 用

各撮像手段の出力は、二値化されてメモリにストアされ、そのメモリのストア内容を読出して三角法に基づいて被計測物体の3次元の形状を演算

-5-

した3次元形状計測装置を提供することである。 課題を解決するための手段

本発明は、複数の異なる位置にそれぞれ配置され、相互に異なる波長を有するバターン光またはスリット光を被計測物体に同時に照射する複数の照射手段と、

前記照射手段に個別的に対応してその対応する照射手段とは異なる位置にそれぞれ配置され、前記対応する照射手段からの前記波長を有する光が照射されている被計測物体を擬像する複数の撮像手段と

前記機像手段からの出力に応答して、機像して得られる画面を多数の画業に分けて明暗の二値化を行い、その二値化信号をメモリにストアし、そのストア内容を説出して三角法に基づいて被計測物体の3次元の形状を演算して求める処理手段とを含むことを特徴とする3次元形状計測装置である。

また本発明は、光照射手段と撮像手段とは、バンドバス色フィルタを備えることを特徴とする3

-4-

して求める。

寒 施 例

第1図は、本発明の一実施例の計測装置20の平面配置図である。被計測物体1の周囲には、複数(この実施例では3)の照射手段6点、66点、66点、6点、10元の実施例では1つの仮想円上で等間隔に)配置される。被計測物体1の周囲にはまた、前記照射手段6に個別的に対応したテレビカメラ8点、85、8c(総称するときは8)が、対応する照射手段6とは異なつた位置に配置される。

照射手段 6 a , 6 b , 6 c の前方には、バンドバス 色フィルタ 2 a 1 , 2 b 1 , 2 c 1 がそれぞれ配置される。またテレビカメラ 8 a , 8 b , 8 c の前方には、バンドバス色フィルタ 2 a 2 , 2 b 2 , 2 c 2 がそれぞれ配置される。照射手段 6 a とそれに対応するテレビカメラ 8 a の前方にそれぞれ配置されている バンドバス色フィルタ 2 a 1 , 2 a 2 は、第 2 図のライン R 1 で示されるような透過率特性を有している。また照射手段 6 b

と、それに対応するテレビカメラ8 b との各前方
'位置に配置されているバンドバス色フィルタ 2 b
1、2 b 2 は、第 2 図のライン G 1 で示される 透
過率特性を有する。さらにまた 照射 手段 6 c とそれに対応するテレビカメラ8 c の各前方位置に配置されるバンドバス色フィルタ 2 c 1、2 c 2 は、第 2 図のライン B 1 で示される 透過率特性を有する。これらの各バンドバス色フィルタ 2 a 1、2 a 2; 2 b 1、2 b 2; 2 c 1、2 c 2 の 透過率
が高い値を有する波長の帯域は相互に異なつている。

第 3 図は、 計 測 装 置 2 0 の ブ ロ ツ ク 図 で あ る。 各 照 射 手 段 6 a 、 6 b 、 6 c は 同 時 に 光 バ タ ー ン 7 a 、 7 b 、 7 c ( 総 称 す る と き は 7 ) を 有 す る バ タ ー ン 光 の 照 射 を 行 う 。 こ れ に 対 応 し て テ レ ビ カ メ ラ 8 a 、 8 b 、 8 c で 撮 像 さ れ た 画 像 は 、 処 理 回 路 9 に 与 え ら れ る 。 処 理 回 路 9 に 関 連 し て 、 画 像 メ モ リ 1 0 と 、 後 述 の 二 値 化 バ タ ー ン 1 7 を ス ト ア す る メ モ リ 1 1 a 、 1 1 b 、 1 1 c ( 総称 す る と き は 1 1 ) と が 設 け ら れ る 。

-7-

簡略化のため、照射手段6 a とテレビカメラ 8 a とを用いた計 3 動作のみを示す。前記液晶スリット板 2 1 の電極 2 5 に選択的に電力を導出することによつて、第 5 図において参照符 2 7 a 2 7 b 2 7 c で示される非透光領域とが形がイコードに従つてコード化された光パターン 7 a と に で か は で が が な た 光 で が が か ら の 光 は 、 グレイコードに従つてコード 化 された 光 パ ターン 7 a と に で 非 計 割 物 体 1 に 照射 される。 透 光 領域 2 7 a 、 2 7 b 、 2 7 c (総称するときは 2 7 ) と 、 非 透 光 領域 2 8 a 、 2 8 b 、 2 8 c (総称するときは 2 7 ) を 、 き は 2 8 )とによって それぞれスリットパターン 2 9 a 、 2 9 b 、 2 9 c (総称するときは 2 9 ) が 構 成される。

たとえば 電極 2 5 a 、 2 5 d 、 2 5 e 、 2 5 h に 電力 が 与 えられて 形成される スリット バターン2 9 c が用いられて、光バターン 7 a の 照射 が 行われたときには、第 5 図 で 示されるような 陰影が現れる。 すなわち 透光 領域 2 7 c を 透過した 光の 帯 が 照射されている 部分 は 白 抜きとなつており、

第4 図は、照射手段 6 a の構成を示す 図である。 照射手段 6 a は、液晶スリット板 2 1 と、処理回路 9 からのパターン信号をデコードして、前記液晶スリット板 2 1 のスリットパターンを変化するデコーダ 2 2 と、光源 2 3 とを含んで構成される。

液晶スリット板21の一方の表面には、縦方向に複数(この実施例では8)に分割されたアノード側透明電極25a.25b,…,25h(総称するときは25)が形成されており、デコーダ22から個別的に電力が与えられる。液晶スリット板21の他方の表面には、共通にカソード側透明電極26が形成されており、この電極26は接地される。電極25,26間に充填される液晶は、、電界を印加することによつて適光性となるものとどちらであつてもよい。本実施例では遮光性となるものを用いる。残余の照射手段6b,6cも同様にして構成される。

第5 図は、計測装置 2 0 を用いた計測方法を説明するための図であり、この第5 図と前述の第3 図とを参照して計測方法を説明する。なお説明の

-8-

非透光領域 2 8 c によつて光が遮断された陰の部分にはハツチングが施されている。

これらのスリットバターン29の透光領域27 および非透光領域28は、非計測物体1の形状計測が可能な領域に対応して示すと、第6図(1),第6図(2)および第6図(3)のようにそれぞれなる。こうして被計測物体1の形状計測が可能な領域は、合計8つの領域部分PO~P7に分割することが可能になる。なお第6図において「0」で示される部分は影の部分であり、「1」で示される部分は影の部分であり、「1」で示される部分は光の帯が照射されている部分である。

被計 割 物 体 1 の 形 状 を 計 測 す る 場 合 、 先 ず 被 計 測 物 体 1 を 照 射 手 段 6 a に よ つ て 光 を 照 射 し な い 状 態 に お い て テ レ ビ カ メ ラ 8 a で 撥 像 を 行 い 、 そ の 画 像 1 5 を メ モ リ 1 0 に ス ト ア し て お く 。 次 に 、 電 極 2 5 a ・ 2 5 d ・ 2 5 e ・ 2 5 h を ハ イ レ ベ ル と し て ス リ ツ ト パ タ ー ン 2 9 c を 形成 し 、 被 計 測 物 体 1 に 光 の 帯 の 照 射 を 行 う 。 こ れ に よ つ て 撮 像 し た 画 像 1 6 を 処 理 回 路 9 に 読 込 む ・ 照 射 手 段 6 a に よ る 光 の 帯 を 用 い な い 無 投 影 時 の 画 像 1 5

と、照射手段 6 a による光の帯の照射時における ・ 画像 1 6 とでは、被計測物体 1 の色やその色の濃 淡などによつて各画面 1 5 , 1 6 の画業のレベル が、たとえば 1 0 0 段階に分けられて構成される。

処理回路 9 は、照射 手段 6 aからの光の帯の照射時における画像 1 6 の各画素 毎の濃淡レベルル R あを使用しない無投影時の画像 1 5 の濃淡レベル S を各画素 毎に引算して、各画素 毎の差 T (T=R-S)を演算し、この差 T であた値でレベル 弁別して、二値化パターン 1 7 を演算して求める。こうして得られる二値化パターン 1 7 を で スリットパターン 2 9 a 、 2 9 b 、 2 9 c の使用の度 年に求め、メモリ 1 1 a にストアする。

被計測物体 1 が暗窒にあるときには、無投影時の濃淡画像 1 5 を得る必要がなく、投影時の濃淡画像 1 6 の各画素をレベル弁別して二値化パターン 1 7 を作成するようにすればよい。

被計測物体1の形状が計測可能な領域における分割された領域部分PO~P7のグレイコードに

-11-

によつて個別的に撮像される。

次に、メモリ11aの特定の位置Qに対応した 画業Qa.Qb,Qcの二値化された論理値を説 取る。たとえば、論理値が「101」であるとき には、第1表から位置Qは領域部分P6に存在す ることが分かる。

こうして、照射手段6 aとテレビカメラ8 aとを結ぶ直線18と、 領域部分P6 と照射手段6 aとを結ぶ直線19との成す角度21と画素2 a、Qb、Qcに基づく位置Qとテレビカメラ8 aとを結ぶ直線20との成す角度22と、予め計測しておいた照射手段6 aとテレビカメラ8 aとの間の距離しとに基づいて、三角法に従つて位置Qを演算して求めることが可能となる。

こうして 求められた 各 画 素 毎 の 位 置 Q を メ モ リ 1 1 a に ストア し、 残 余 の 照 射 手 段 6 b . 6 c お よ び テ レ ビ カ メ ラ 8 b . 8 c に つ い て も 、 照 射 手 段 6 a お よ び テ レ ビ カ メ ラ 8 a と 同 時 に 、 同 漿 の 動 作 を 行 い 、 各 画 素 毎 の 位 置 Q を そ れ ぞ れ メ モ リ 1 1 b . 1 1 c に スト ア す る 。 各 照 射 手 段 6 お よ

よる分離値は、第1表のとおりとなる。

			第 :	) 表	
		領域	スリット バターン	スリットバターン	スリツト パターン
	位	部分	29 a	29b	29 c
	Œ	P 0	0	0	0
1	針	P 1	0	0	1
	測	P 2	0	1	1
1	घ	Р3	0	1	0
	能	P 4	1	. 1	0
	な	P 5	1	1	1
1	領	P 6	1	0	1
	域	P 7	1	0	0

第7図は本発明の原理を説明するための図であり、第7図および第5図を参照して、メモリ11 a から読出した二値化パターン17に基づいて、被計測物体1の特定部分の位置Qを求める原理を説明する。先ずスリットパターン29a,29b,29cを開城は、領域部分P0~P7に分割される。この各スリットパターン29a,29b,29cによる光の帯の各照射状態は、テレビカメラ8a

-12 -

びテレビカメラ8の相互の位置関係は予め分かかつており、被計測物体1の近傍の空間をコード化することができ、したがつてこうして得られた各時報を処理回路9で相互に関連づけることができる。また各カメラ8の画角の周縁部のは相互に重なつており、したがつてこの周縁部のデータを切捨てることによつて正確な3次元情報を得ることができる。

このように、本件計測装置20では、被計測物体1を複数のコード化された各光パターン7年の被計測物作1の画面を多数の画案に分けて明暗の二値化パターン17を作成し、被計測物体1の位置からその3次元形状を演算して求めるようにしたので、非の数の光パターン7で被計測物体1を多数の領域の計測を行うことができる。

また液晶スリツト板21を用いて光バターン7

を形成するようにしたので、高速度にスリットバ ツーン 2 9 を変更することができ、したがつて被 計 調物体 1 の 3 次元形状を簡単な構成で高速度に 計 測することができる。

さらにまた、グレイコードに従うスリットバターン29によつて光バターン7が作成されるので、光の帯の境界付近における論理ピットの読誤りは、 隣接する領域部分PO~P7が1つずれるだけであり、計測誤差を減少することができる。

上述の実施例では、光パターンフは縦縞であったけれども、横縞であるよく、またドットであってもよい。また液晶スリット板21に代えてを形成し、この陰極線管からの画面を被計測物体1に直接または集光レンズを介して照射するようにしてもよい。この場所は一段によって各種な光パターンは、画像形成手段によって各種な光パターとので、被計測物体1の形状に最適な光パターンを比較的容易に実現することができる。さらにまた、陰極線管に代えて、プラズマ表示手段や多

-15-

ブロツク図、第4図は照射手段6aの構成を示す図、第5図は計測方法を説明するための図、第6図はスリットバターン29を用いた計測可能な領域の分割状態を示す図、第7図は本発明の原理を説明するための平面図である。

1 … 被計測物体、2 a 1 、2 a 2 ; 2 b 1 、2 b 2 ; 2 c 1 、2 c 2 … バンドバス色フイルタ、6 … 照射手段、7 … 光パターン、8 … テレビカメラ、9 … 処理回路、1 0 、1 1 … メモリ、1 5 、1 6 … 画像、1 7 … 二値化パターン、2 0 … 計測装置、2 1 … 液晶スリット板、2 2 … デコーダ、2 3 … 光源、2 7 … 透光領域、2 8 … 非透光領域、2 9 … スリットパターン

代理人 弁理士 西數 圭一郎

数の発光ダイオードによつて構成された表示手段などが用いられてもよい。

上述の実施例では、光パターンを有するパターン光が用いられたけれども、本発明の他の実施例として、単一または複数のスリット光を用いて被計 測物体の 3 次元形状を計測するようにしてもよい。

バターン光およびスリツト光は、可視光であつてもよいし、赤外線などであつてもよい。

#### 発明の効果

以上のように本発明によれば、被計測物体の3次元形状を非接触で計測することができ、しかも各照射手段から同時に、かつ、相互に波長の異なる光を照射して、高速に計測を行うことができ、しかも構成が簡単である。

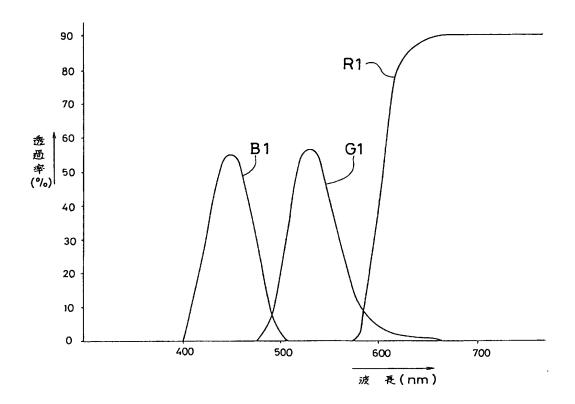
#### 4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の計測装置20の平面配置図、第2図はバンドバス色フィルタ2 a 12 a 2; 2 b 1, 2 c 2 の各透過率特性を示すグラフ、第3図は計測装置20の

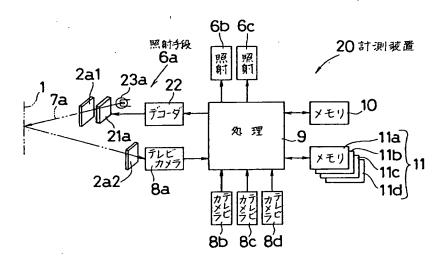
-16-

第 1 図

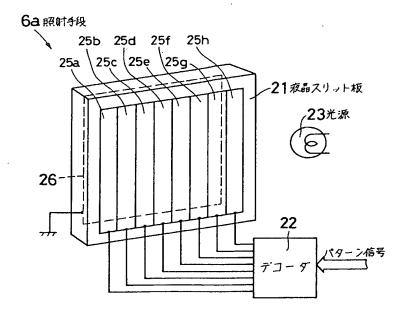
第 2 図



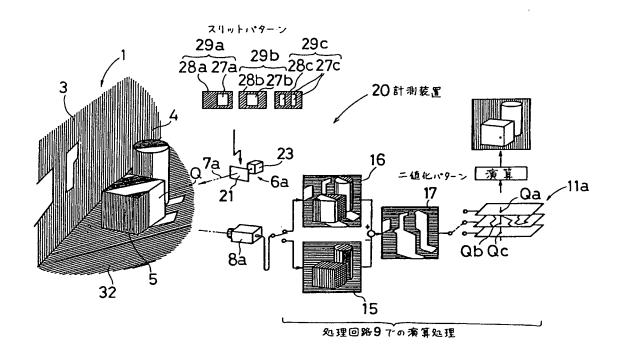
第3図

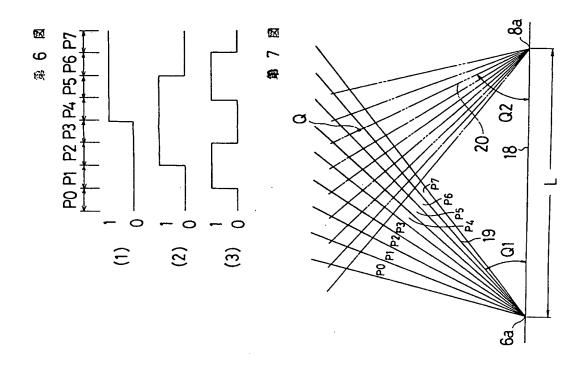


### 第 4 図



## 第 5 図





第1頁の続き ②発 明 者 深 谷 典 行 大阪府大阪市住之江区南港東8丁目2番12号 株式会社オ ージー情報システム総究南港研究所内 ②発 明 者 平 島 充 雄 大阪府大阪市住之江区南港東8丁目2番12号 株式会社オ ージー情報システム総究南港研究所内